rily.

# BEST AVAILABLE COPY

(USP 4.557868)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-28557

@Int Cl.1	識別記号	<b>庁内整理番号</b>	43公開	昭和61年(1986)2月8日
C 09 B 47/00 C 09 C 1/00 G 03 G 5/06	3 0 2	8018-4H 7102-4J 7124-2H※審査請求	未請求	発明の数 1 (全23頁)

❷発明の名称

バナジルーフタロシアニンの製造方法

创特 顧 昭60-133907

1995 顧 昭60(1985)6月19日

優先権主張 砂1984年6月26日⊗米国(US)砂624652

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ロチエスター,テイタス 母発 明 者 ジョフレイ アリソン

アベニュー 2621

エメリイ グスタブス 個発 明 アメリカ合衆国ニユーヨーク州ロチエスター、トリントン

ドライブ 92

@発 明 者 ロバート トーマス アメリカ合衆国ニユーヨーク州ロチエスター、トレイドワ

コスグローブー インド ドライブ 12

⑪出 願 人 ゼロツクス コーポレ アメリカ合衆国ニユーヨーク州ロチエスター。ゼロツクス ーション

スクエアー (番地なし)

②代 理 人 弁理士 茂 村 外2名

最終頁に続く

#### 1. 発明の名称

パナジル・フタロンアニンの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 五酸化パナジウムとフタロニトリルおよび少 なくとも180℃の沸点を有するアルコールとを、 少なくとも発熱温度において反応させ、得られた 反応混合物を濾過して反応生成物質料ケーキ (cake)を生成させ、この反応生成物類料ケーキ を双性中性溶剤で少なくとも一回洗滌して処理さ れた顔料ケーキを生成させ、この処理された顔料 ケーキを乾燥し、眩処理された顔料ケーキを攪拌 しながら水で希釈した強酸で浸出し、得られた混 合物を碰過して浸出された顔料ケーキを生成し、 との提出された顔料ケーキを水で希釈した強酸で 少なくとも1回洗除して洗滌された浸出銀料ケー キを生成させ、眩受出顕料ケーキを水を含む密剤 で少なくとも1回洗滌して水洗された浸出顕料ケ ーキを生成させ、この水洗された浸出顔料ケーキ を水で希釈された強塩基と結合して強塩基スラリ

ーを生成し、この強塩基スラリーを提拌しまがら 加熱し、得られた混合物を濾過して強塩基で処理 された額料ケーキを生成し、この強塩基で処理さ れた顔科ケーキを双性中性溶剤と結合して溶剤ス ラリーを生成し、この格剤スラリーを攪拌したが ら加熱し、酸溶剤スラリーを濾過して溶剤で処理 された顔料ケーキを得、この密剤で処理された水 を含む溶剤と結合して水性スラリーを生成し、と の水性スラリーを提押しながら加熱し、該水性ス ラリーを確遇して洗滌された顔料ケーキを得、と の洗滌された顔料ケーキを乾燥し、この洗滌され た類科ケーキを撹拌しながら冷却された濃強酸に 増加的に溶解してペナジル・フタロシアニンの冷 却された農強政語液を生成し、この春液を攪拌し ながら冷却水と混合して沈敷したパナジル - フタ ロシアニン粒子を含む混合物を生成し、この得ら れた混合物を構造して沈殿したパナジル・フタロ シアニン粒子のケーキを得、この沈殿パナジルー フォロシアニン粒子ケーキを水を含む密剤と混合 してペナジル・フタロシアニン粒子と水のスラリ

特徴昭61-28557(2)

- (2) パナジル・フタロシアニンの前配冷却された 優強酸を、約15℃以下の温度に維持することを 包含する、特許請求の範囲第1項記載のパナジル-フタロシアニンの製造方法。
- (3) ペナジル・フタロシアニンの冷却された前記。

溶液を、約5℃~約10℃の温度に維持することを包含する、特許請求の範囲第2項配収のパナジル・フタロシアニンの製造方法。

- (4) 前記洗滌された 銀料ケーキ と結合した前記冷却された強酸が、少なくとも 9 5 % (重量)の機度を有する確保である、特許請求の範囲第 1 項記載のペナジル・フタロシアニンの製造方法。
- (5) フタロニトリル: 五酸化パナジウムのモル比が、 約10:1 かよび約14:1 の間にあることを包含する、特許請求の範囲第1項記載のパナジル-フタロシアニンの製造方法。
- (6) 前記アルコールが少なくとも2個のヒドロキシル基を有する、特許請求の範囲第1項記載のパナジル-フタロシアニンの製造方法。
- (7) 少なくとも2個のヒドロキシル基を有するアルコールがエチレングリコールである、特許翻求の範囲第6項配数のパナジル-フタロンアニンの製造方法。
- (8) 前記アルコール: 前記五酸化パナジウムの重 貴割合が、約3:1 および約30:1の間にある。

特許請求の範囲第1項記載のパナジル~フタロン ブニンの製造方法。

- (9) 前配反応生成物類料の前記洗滌のための前記 双性中性溶媒を、少なくとも80℃の温度に維持 する、特許額求の範囲第1項記載のパナジル-フ タロシアニンの製造方法。
- (II) 前記強塩基で処理された顔料ケーキを双性中性溶媒と結合して前記溶媒スラリーを生成し、との溶媒スラリーを撹拌しながら加熱し、該溶媒スラリーを濾過する前記工程を少なくとも1回線返すことを包含する、等許請求の範囲第1項記載の
  - U) パナジル・フタロンアニン粒子の前配ケーキを水と結合する前に、パナジル・フタロシアニンの前配ケーキを水および弱塩基と結合して弱塩基スラリーを生成させ、この弱塩基スラリーを選押しながら加熱し、この弱塩基で処理された パナジル・フタロシアニンの弱塩基で処理された 類科ケーキを少なくとも1回得ることを包含する、 特許請求の範囲第1項記載のパナジル・フタロシ

アニンの製造方法。

- 12 前記器塩基が水酸化アンモニウムである、特許請求の範囲第11項記載のパナジル フタロシアニンの製造方法。
- 44 前記処理された顔料ケーキを、アルコール溶 媒を用いて少なくとも1回先離し、アルコールで 洗滌された顔料ケーキを生成させることを包含す る、特許請求の範囲第1項記載のペナジル・フタ ロシアニンの製造方法。
- は 前記を出の前に、前記処理された額科ケーキを、水で希釈した強塩 あと結合してスラリーを生成し、このスラリーを撹拌しながら加熱し、このスラリーを健遇して額料ケーキを生成させ、次い

でこの顔料ケーキを少なくとも1回洗滌すること を包含する、特許請求の範囲第1項記載のパナジ ル-フタロンアニンの製造方法。

QQ 前記処理された級料ケーキ受出用の水で希釈された前記強敵が、約60多(重量)~約80多(重量)の設度である、特許請求の範囲第1項記載のペナジル・フタロシアニンの製造方法。

(17) 前配双性中性溶媒が、N.N-ジメチルホルムアミドである、特許請求の範囲第 1 項記載のパナジル・フタロシアニンの製造方法。

18 前記強塩蒸が水酸化ナトリウムである特許 財 水の範囲第1項記載のパナジル・フタロシアニンの製造方法。

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、フタロシアニン組成物の改良製造方法に関する。更に詳細には、本発明は、ペナジルフタロシアニンを反応によつて生成し、処理することにより、改良された電子写真用性質を達成させる方法に関する。

静電的手段によつて、光導電性部材の像形成性

> 無機物質または有機物質を含む光受容器材料、 その荷電キャリヤー発生作用かよび荷電キャリヤーを連ぶ作用は、別圏の隣接している層によって 成就される、光受容器材料は知られている。 分離 した発生層かよび輸送層から成る要置を有する、 層になっている光応答要置は、例えば米國特許 第4.265.99 日号に記載されている。また、層に

表面に静電潜像を生成させ現像することはよく知られている。一般に、この方法は、当業界において、光受容器と称せられている電子写真板の表面上に静電潜像を形成することを包含している。通常、この光受容器は、導電性基体、および光導電絶級物質の1層またはそれ以上の層から成立で表を影響である。選ましくない放電を防ぐために、導電性基体と光導電性層との間に、遮断層(barrier)を挿入することができる。

なつている光受容器物質は、電気絶縁、重合体物質 のオーパーコート層を有する従来技術に記載され ている。

孔射出層を含むオーバーコートされた光応答性物質、孔輪送層を有するオーバーコート、次の写真生成性層のオーパーコーテイング、および絶縁性有機樹脂の外部被優は、例えば、米国等許

第4,251.612号に記載されている。これらの 特許に記載された写真生成性層には、例えば、三 方晶セレニウム、およびフタロシアニン、および ある種のツアミンを含有する輸送層が包含されて いる。米国等許第4.265.990号および米箇等 許第4.251.612号の全記載は、本明細書の記 載として提用する。

ある種のフォロシアニン組成物は、 それを光応答装置に組込みその装置の可視光線をよび赤外線を包含する光に対して光応答性能を拡げるのに有用である。 これらの光応答装置は、 例えば従来の電子写真複写機をよびレーザー印刷機に 利用することができる。 更に、 これらの光応答装置は、 写

真生成性層の中に、写真生成性層と孔輸送層との間に、または、写真生成性層と支持基体との間に、フタロシナニン組成物を包含する光導電性物質を含む単一層または多層の部材から成つている。

ペナジル・フタロシアニンが、光応答装置のために特に適当であることが見出された。ペナジル・フタロシアニンを製造し処理するための多数の方法が知られている。これ等の方法は、例えば米国特許第 2.1 5 5.0 3 8 号かよび米国特許

第3.825.422号に記載されており、とれ等の中には、フタロニトリルと五酸化パナジウムを唇剤の不存在下で反応させることが記載されているよる。種々の他の例も米園特許第3.825.422号かよび米園特許第4.032.339号に記載されてかり、これ等の中には、パナジルーフタロシアニンを扱ったのでは、パナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、パナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、ナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、ナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、ナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、カナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、カナジルーフタロシアニンを製造するための反応は、カナジルーフタロシアニンを製造するための反応によるい。何故なら、三塩化パナジウムは、不安

パナジル - フタロシアニン粒子は、簡単に、適当な粒子サイズに物理的に粉砕することはできない。 何故なら、粉砕工程において、比較的大きな粒子を含有する非常に大きな粒子サイズ範囲分布を有する粒子を生成する傾向があるからである。粉砕されたパナジル - フタロシアニン粒子の分級は、時間の消費になり、かつ収率はよくない。

ゼログラフィー(Xerography)の技術は進歩し続ける故に、より厳密な標準に、性能を改良しかつ高質の像を得るために、電子写真像形成性要置が合うようにするととが必要である。また、窒ましいことは、可視光、および/またはレーザー印刷に使うための赤外線照射に、より多く応答する際化された光応答装置である。これらの電子写真製品は、更に精巧になり、かつ高速度において操作されるようになるので、操作の許容度は、極めて厳しくなり、かつ部品類の電気的挙動の予測能力は特に臨罪的となる。

". If the property of

パナジル - フタロシアニンを製造する従来方法は、その意図する目的のためには適当であるかも

定と塩化水素の生成の一因となる加水分解性の活性合物であるからである。

フタロシアニンは、例えば米国特許第 2:155D38 号、同第 3.7 1 7.4 9 3 号、同第 3.8 2 5.4 2 2 号、同第 4.0 3 2.3 3 9 号、同第 4.0 7 6.5 2 7 号、英国特許第 5 0 2.6 2 3 号(完全明細智は 1 9 3 9 年 3 月 2 2 日 に受入れた)、 および 特顧 昭 4 9 - 4 3 2 6 4 号(1 9 7 4 年 1 1 月 2 0 日 に公告された)に配述されている如く、硫酸と反応させることができる。

しれないが、予測能力のある電気的性質を有する パナジル・フタロシアニンを製造する改良方法の 必要性は存在し続けるであろう。 発明の概要

それ故、本発明の目的は、ペナツル・フタロシアニン組成物を製造する改良された方法を提供することである。

本発明の他の目的は、確実に再現性のあるパナ ジル・フォロシアニンの改良製造方法を提供する ことである。

本発明の他の目的は、非常に小さい平均粒子サイズを有するペナジル - フタロシアニンの改良製造方法を提供することである。

本発明の他の目的は、ほとんど不純物のないパナジル・フォロシアニンの改良製造方法を提供することである。

本発明の他の目的は、高収率でペナジル - フタロシアニンを製造する改良方法を提供することである。

本発明の他の目的は、高感度電子写真性を示す パナジル - フォロシアニンの改良製造方法を提供 することである。

本発明の他の目的は、光受容器の低暗波衰を与

えるパナジル・フタロシアニンの改良 製造万法を 提供することである。

本発明の他の目的は、光受容器の低残留電荷を示すペナジル - フォロシアニンの改良 製造万法を 提供することである。

この水洗された漫出顔料ケーキを水で希釈された 強塩基と結合して強塩基スラリーを生成し、この **随塩基スラリーを撹拌しながら加熱し、得られた** 混合物を濾過して強塩基で処理された顔料ケーキ を生成し、この強塩基で処理された顔料ケーキを 双性中性密剤と結合して密剤スラリーを生成し、 この洛剤スラリーを撹拌しながら加熱し、 該溶剤 スラリーを濾過して密剤で処理された貿科ケーキ を得、この溶剤で処理された水を含む溶剤と結合 して水性スラリーを生成し、この水性スラリーを **選拌しながら加熱し、該水性スラリーを濾過して** 洗滌された照料ケーキを得、この洗滌された腹料。 ケーキを乾燥し、この洗滌された顔料ケーキを攪 拌しながら冷却した強酸に増加的に溶解してペナ . ジル・フォロシアニンの冷却された溶液を生成し、 この密液を提拌しながら冷却水と混合して沈殿し たパナジル・フォロシアニン粒子を含む混合物を 生成し、この得られた混合物を濾過して沈殿した パナジル・フォロシアニン粒子のケーキを得、こ の沈殿パナジル・フタロシアニン粒子ケーキを水

を含む溶剤と混合してパナジル・フォロシアニン 粒子と水のスラリーを生成し、このパナジル・フ タロシアニン粒子と水のスラリーを加熱し、得ら れた混合物を濾過してパナジル・フォロシアニン 粒子のケーキを得、この沈殷したパナジル・フォ ロシアニン粒子のケーキを水を含む溶剤と混合し てパナジル・フォロシアニン粒子と水 のスラリー を生成し、このパナジル・フォロシアニン粒子と 水のスラリーを加熱し、得られた混合物を濾過し てパナジル・フタロシアニン粒子のケーキを得、 このパナジル・フタロシアニン粒子のケーキを水 と混合して水のスラリーを生成し、この水のスラ リーを濾過してペナジル・フォロシアニンの精製 された顔料ケーキを生成し、次いでこのパナジル - フォロシアニンの精製された顔料ケーキを乾燥 させる、方法によつて選成される。

本発明の改良製造方法は、説明を容易にするために3つの段階に分けられるが、これら路段階は相互に関係があり、個々にかつ共同して最終題科生成物の重要な再現性のある電気的特性に貢献す

る。

最初の段階(段階 I)は、粗パナジル・フォロシアニンの合成に関している。

本発明方法に用いる出発反応体は、五酸化パナシウム、フタロニトリル、およびエチレングリコールである。反応混合物におけるフタロニトリル:五酸化パナジウムのモル比は、好ましくは約10:1 だよび約14:1 の間である。フタロニトリルのより多くの過剰は、副反応に生成物である。からなければならない多くの副反応生成物できない損失を招来する。前述のモル比が12:4:1 より少ない値に減少するときは、収率は仕込んだパナジウムの当量(equivalents)に基づいて減少する。それは、12:4:1 およびそれ以上のモル比において、全ての仕込 V20。はパナジル・フタロシアニンに販化する。

2個以上のヒドロキシル塞を有しかつ少なくと も約180℃の沸点を有する任意の適当なアルコ ールを使用することができる。約180℃以下の

Tルカール: 五酸化パナジウムの割合は、好ましくは約3:1および約3日:1の間にある。反応混合物には、この混合物が発熱温度に選するように充分な加熱がなされるべきである。発熱温度は、パッチ温度が昇温時間中においてジャケット 温度を越える時に、本方法において選成された最大温度として定義する。

反応中、反応混合物を提拌することは重要である。激しく提拌することが好ましい。この提拌は、

夢点は通常避けるべきである。 何故なら、 反応混 合物が発熱温度に達する前に、 アルコールが沸騰 するからである。発熱最大温度より低い温度で部 雌 するアルコールを用いると、 粗パナジル・フォ ロシアニンの収率は有意に減少する。おそらく低 い温度においては圧力容器を使用することができ るが、そのようなより多く費用のかかる装置を必 要とすることは、標準の工業用装置が適当な温度 および大気圧下で殆んど定量的な収率を与えると き、不経済となるであろう。典型的な多官能性で ルコールは、主チレングリコール、プロピレング リコール、プチレングリコール、グリセロール、 および少なくとも約180℃の沸点を有する任意 の他のモノまたはポリオールである。最適収率は エテレングリコールで達成される。エチレングリ コールは高価でなく、純粋で、かつ多量に利用さ れている。反応を通して容易に攪拌される流体と して、フォロニトリルを容解しかつ反応混合物を 維持するために充分なアルコールを使用すべきで ある。好ましくは、この充分なアルコールは、反

適当な提押手段、例えばプロペラ式ミキサー、磁気パー式ミキサー等、によつてなされる。反応混合物の乱流を促進するために、反応容器に、じやま板、不規則な内部要固等を含ませることができる。 典型的な混合製置は、Eじやま板および3.73 馬力のモーターによつて100 rpm 回転する3枚羽根プロペラ式攪拌機を有する10ガロンのプハウドラー グラステール(Pfaudler Glasteel)反応器である。

反応は、減圧、大気圧、または適圧下で行うことができる。 選ばれた圧力は、使用されるアルコールの沸点、および発熱適度を選びられての正力の効果のような因子に依存する。 狭するには、 正力は、 反応混合物が発温 さっている 選流するような低に あっている 更に、 適圧は、 アミルアルのような低沸点アルコールを用いるとき使用できるが ではない。 一般に、 大気圧下の反応は、 特別ない。 一般に、 大気圧下の反応は、 特別ないの 医数量の必要性を避け、かつ反応を遂行するため

のエネルヤー消費を最小にすることが好ましい。 例えば、反応器は、 密剤蒸気を凝縮するのに充分 な容量を有する大気に関放された単純な水冷の選 流冷却器を単に取り付けるだけでよい。

本発明方法および装置のより完全な選解は、本 発明方法における反応退合物(パッチ)および加 熱マントルまたはオイル循環谷(ジャケット)の ための典型的な温度対時間の関係をグラフで説明 している欲付図を参照することによつてなされる。

ト、電気マントル、加熱オイル循環浴等がある。 冷却は、単に反応容器に対する加熱を終了させる ことによつて行われる。所盛により任意の適当な 従来の手段を用いることによつて冷却促進させる こともできる。

しかし、温度増加率においてかなりの寛容度が観察された。四から明らかな知く、シャケット温度は、最初の時間零において反応混合物の温度より高い。更に、ジャケット内の加熱媒体の温度は、反応混合物の温度は、ジャケット内の温度な越えて上昇する。これは、発熱反応の間に反応混合物中に発生した熱に基因する。

反応の次の部分は、反応復合物(パッチ)の温度を発熱の初めの温度以上に上げなければならない、かつ反応の実質的完了までまた発熱が静まる (パッチ温度が減少し始める)まで発熱温度を維持しなければならない、特別な臨界的期間である。

反応の実質的完丁後(図において約5.55時間) 反応混合物の加熱を止める。反応段階に続くこの 第3の部分は特に臨界的ではなく、冷却を行う方 法にはかなりの寛容度が観察された。反応混合物 を加熱するのにオイルシャケットが使用されるが、 他の適当な従来の加熱装置を使用することができ る。典型的な加熱手段には、加熱オイルジャケッ

媒を使用することは、その容媒によつて不純物の より多くの効果的除去を促進するパナジル・フタ ロシアニンの少しの彫慣の原因となると個んじら れている。少なくとも約80℃の密鉄温度は、不 純物の急速除去のためには好ましい。w,w-ジ メチルホルムアミドは好ましい双佐中佐群媒であ る。何故なら、この密媒は、80℃およびそれ以 上の温度で安定であり、純粋であり、 多量に利用 でき、かつ他の双性中性容媒よりも費用がかから ないで、しかも膨潤した顔料から不純物を除去す る他の溶媒と同等な溶媒能力を持つているからで ある。洗滌は、通常、フイルター上にある鍜料ケ ーキ上に双性中性溶媒を加えることによって行わ れる。洗滌工程は少なくとも1回行われるが、所 盛により繰返して行うこともできる。 更に、 顔料 ケーキを、アルカノールのような適当な溶媒で迫 加的に洗練することもできる。典型的なアルカノ ールには、エタノール、イソプロパノール、プタ ノール等が包含される。この洗滌工程は、アルカ ノールと相辞性である若干の麒科を設収した双性

. . 454

中性審集の除去を高める。アルカノールは、水と相審性である。アルカノー和密性である。アルカノー和密性である。何故なおり、加力ないないのである。自程または、かつよく除去ノールなりである。自程または、た際前にアルカールな子の関係により効果的にかつより急速に発去するために好ましい。

基スラリーおよび水洗後の)には、湿つた顔料ケーキを、熱対流エアーオープン中のオープントレー中に、約65℃~約70℃で少なくとも約96時間置くか、または一定の重量が得られるまで置くことが包含される。

部分的に乾燥した解料を、乳鉢および乳棒、ウオーニング プレンダー(Warning Blender)等のような適当な手段を用いて軽く粉々にし、急速な乾燥を容易にするために部分的に乾燥した顔料の表面積を増加させる。乾燥は、溶媒含量が乾燥した顔料の全度量に基づいて約19(重量)以下で一般である。砂木化した乾燥顔料は、次の加工工程の間直接の電光から保護することが好ましい。

本発明の第2の段階(段階I)は、ペルぁトイド影渦(permutoid swelling)を包含する最初の精製工程である。ペルムトイド影響は、ペナジルーフタロシアニンのプロトン化された形を要す
75多低酸影調ゼラチン状塊から化学不純物を受出することである。

前記器工程から得られた顔料ケーキ(これは、双性中性溶媒処理の後で得られたケーキであってよい。何故なら、次の任意的工程は省くことができるからである)を乾燥し、粗顔料を洗滌するのに使用した溶媒を除去する。乾燥は、従来の適当な手段、例えば熱対流エナーオープン、真空オープン等、によつて行なう。典型的乾燥方法(強塩

乾燥し粉末化した組顱料を強酸で処理する。パ ナジル・フタロシアニン題料を彫刻することが可 能な、かつその中に存在している不純物を溶解す ることの可能な適当な強い有機酸または無機酸を 使用することができる。典型的な強酸には、硫酸、 **頻酸、メメンスルホン酸等が包含される。強酸の 濃度は、約70多(重量)~約80多(重量)で** あるべきである。約609(塩盤)以下の強酸機 度には、粗顱料から不純物を十分に除去する効果 は余りない。また、80多(重量)の酸強度では 収率が低くなる。硫酸は、純粋でありかつ高価で ないために好ましい強酸である。酸によつて裕解 される不範物には、フタルイミド、フタル酸、フ タルアミン酸、およびフタルジアミドがある。粉 来化し乾燥した粗顔料を、室温において攪拌しな がら、冷却した酸に、徐々にかつ増加的に添加す べきである。顔料を、恐らく加水分解の工程を通 つて類料の小量の分解の原因となる温度の過度の 増加を避けるために、混合物を宝温近くに維持す るのを助けるように、徐々に添加する。酸裕を、

添加時間を通して全ての圏科芝子を影響したピラチン状態を得るように提押し、次ので3時間提押する。これは、全容鉄との接触を確実にするためであり、これによりであり、これによりであり、これによりであり、これによりである。 題科は、かというで、酸で使出された似料は、 前述の如き従来のは 過で、酸で 後出された 似神は、 前述によって は 過でる。 その 結果 得られた 濾過ケーキを、ほぼ 医過において新しい 酸を 追加ケーキを、ほぼ 医過において新しい 酸を 追れた 化洗 維する。

酸洗滌後の
既料ケーキを、子の暖められた適当
な 部蝶を用いて洗滌し酸を除去する。好ましくは、
洗滌液は脱イオン水である。しかし、 所望により、
アルコールまたはアルコール - 水混合液のような
他の高価な 溶媒を 窓温において用いることができ
る。経済的 選由から、 洗滌は、 前の 濾過工程から
の 顧料ケーキがフイルター上に 標留している間に
行うのが好ましい。

その後、双性中性溶媒を除くために、類科ケーキを、脱イオン水のような適当な溶媒を用いてスラリーにする。好ましくは、このスラリーを、約70℃~約75℃の温度に加熱する。典型的にはこのスラリーを前配高温において約1時間保持する。次いで、このスラリーを前述の如き従来方法によつて渡過し、乾燥して顔料ケーキ中の水分含

次いで、洗滌後の類料ケーキ、または スラリーの濾過後の銀料ケーキを、双性中性溶媒 と組合せてスラリーに生成し、微処理工程中に除去できな

量を約19(重量)以下の水に減少させる。 の含量は、次工程におけるでは、過度の名を防 のに重要である。典型的には、顔料を、例えば 65℃~約10℃に維持された熱対流エフーは が少中のトレー中に置き、少なくとも約1ーは 適当に乾燥する。部分的に乾燥をのトレー酸の は塊を、より急速な乾燥および次工程の 積製工程においてより急速な溶解をなさしめるた めに軽く粉々にする。

本発明方法の最終段階(段階 II)は、酸によるペースト化を包含する最後の精製工程である。酸によるペースト化は、95岁以上またはそれと削等の硫酸に類料を溶解し、この類料を沈殿させて、不納物を除去し、粒子サイズを減少させることを要する。溶散および沈殿生成のためには高度に調節された条件を必要とする。

次いで、乾燥し粉末化したパナジル~フタロシアニン類料を冷却された強酸と混合する。 パナジル・フタロシアニン類料を完全に풤解することが可能な、かつその中に存在している不純物を熱解

することの可能な適当な強い有機酸または無機酸 を使用することができる。典型的な強敵には、硫 酸、燐酸、メダンスルホン酸等が包含される。磁 酸は、純粋でありかつ高価でないために好ましい 強酸である。強敵の農産は少なくとも95ヵ(重 量)であるのが好ましい。約93g(重量)また はそれ以下の強酸の機度は、その酸で処理された パナジル・フタロシアニン顔料が使用されている 光昊祭器が受け入れられないほど高い暗放表特性。 を示す原因となる。酸の温度は約15℃以下に維 持するのが好ましい。ただし、例えば22℃のよ うな高さの短時間の鑑度の突出は許容される。し かし、ほぼ室温(約22℃)において持続して維 持された温度は、敵処理されたパナジル - フタロ シアニン顔科が使用されている光気容器が受け入 れられないほど高い暗放表特性を示す原因となり、 これは明らかに持続して維持された高温処理から 生成され保持された不純物に基因する。最適の結 果は、酸の温度を約5℃~約10℃に維持すると きに達成される。落放中に生成する不純物の量は、

區度および帶貿時間によつて増加する。粉末にし かつ乾燥した乾燥額料は、15℃以下の温度で、 酸を攪拌しながら、ゆつくりとそして量を増加さ せながら添加すべきである。類料は、持続して維 持された時間の間、約15℃を越える温度の過度 の温度上昇を避けるためにゆつくり添加する。酸 裕を散しく撹拌し、潜液温度を更に均一に維持し、 かつ酸の中に類料が急速に密解するのを促進させ る。額科は、約2時間~約6時間、酸溶液中に入 れて置く。約6時間以上の帯留時間は、受け入れ 難い多量の不純物を生成させる原因となる。約2 時間以下の滞留時間は、顔料の量および溶解速度 との関連において、使用される酸の量によつて実 行可能である。未整解の類科は、次工程において 氷水で冷却すべきではない。何故なら、それは高 暗放表特性を有する装置を招来するからである。

次いで類科 - 酸 溶散は、 挽拌 しながら、 ゆつく りとそして量を増加させながら、 氷水浴中に 添加 すべきである。 所望により、 水と 相溶性であり か つ酸と非反応性の適当な溶媒、 例えばアルコール

類、の少量を、氷水浴中に加えることができる。 しかし、氷水浴中には、酸-類料溶液から不納物 を帮解するのに充分な水を含有させるべきである。 類科 - 散潜液は、持続して維持された時間の間、 約15℃を越える浴温度の有意な温度上昇を避け るため、また、小さい類料粒子サイズおよび不純 物が最も少なく生成されるのが確保されるように、 ゆつくり忝加する。進度の高裕温度は、類料の不 都合な急速な加水分解、生成された顔料の聚集、 および顔料聚集物中への不純物の捕捉等の原因と なる。酸で処理された顔料は、1種以上の流れの 。 ででは、comの形式における氷水浴中に導入し、脂の急速な消失。 を促進させることができる。この導入は、強敵中 における顔料の滞留時間を不都合に延ばすような ・ほどゆつくりであつてはならない。それによつて 氷水中に冷却する前に高水準の不純物量が生成さ れるからである。典型的な導入時間は、約1.75 ~ 2 時間である。例えば、優秀な結果は、脱イオ ン水および氷を含有する裕中に、約15日~約. 2001/分の単一の流れ供給速度で得られる。

好ましくは、顔料を、約15℃以下に維持された 裕温度で、約0.1ミクロン以下の平均粒子サイズ を形成するのに充分な速度で、氷水浴中に導入す る。この浴は、均一な浴温度を保持しかつ氷水浴 中に顔料が急速に分散するのを促進させるために、 放しく提择しなければならない。このためには、 俗を激しく攪拌することが可能な、例えば能述し た如き徳来の適当な攪拌手段を用いることができ る。反応混合物中の乱旒を促進させるために、反 応容器中に、じやま板および不規則な内部表面等 を設けることができる。氷の固体片(1961bs の1部)を、浴が持続して維持された時間約15 ℃以下の温度に維持されるのを確保するために、 俗に週期的に添加する。しかし、氷片は、浴の適 当な攪拌に逆影響を与えるような量であるべきで はない。最適な結果は、浴の温度が約5℃~約 10℃の温度に維持されるとき選成される。所望 により、他の適当な冷却手段、例えば浴中に受し た胎却された治却用コイル、を氷片に監摸をまた は氷片と共に使用することもできる。しかし、内

部に加えられた氷より外の他の適当な冷却源を使用するならば、冷却水の相応量が氷の代りに用いられるべきである。顔料は、約5時間まで氷水下中に入れて置き、次いで前途した如きまた以手段が適過する。得られた渡過ケーキは、海斗上で、予め温められた脱イオン水で洗練し、次、でで、この熱い顔料スラリーを真空濾過する。

リーに生成しなければならない。その後、最終の 光受容器における受け入れ難い暗滅衰を防ぐため に、少なくとも1回濾過しなければならない。典 型的には、この最初のスラリーは、約70℃~約 75℃に加熱し、この高温で約1時間保持する。

る工程は、遮欲の導電率を約10マイクロモー (micromhos)以下に減少させるのに充分な回数 行うべきである。もし波波の導電率が約10マイ クロモー以上であるならば、最終の光受容器は受 け入れ難い暗波表を示すことが見出された。

次いで、類科ケーキを、任意の適当な従来技術を用いて乾燥する。トレー中の類科の塊は、、好料しくは、乾燥中に少なくとも1回粉々にし、顔料を子の表面積をより多く彫出させる。典型された顔料を、例えば約65℃~約70℃に維持された。触対流エアーオープン中のトレー中に、少かされたといった。約96時間働くことに免金な乾燥は、65℃~70℃において約05粒次銀の真空度の支オープン中において乾燥させるような使はまった。次16時間またはそれ以上の時間を使することによって選成することができる。次いで、親科を袋に入れ光のない所に貯える。

本発明を、次の特に好ましい実施例に関連して 詳細に説明する。勿論、これら実施例は例示的な ものであつて、本発明が、これら実施例の材料、 条件、方法等に限定されるものではないことは容 易に理解されよう。実施例中の全ての部および多 は、特にことわりなければ、重量によつて示す。

実施例 1

段階]: 粗パナジル - フタロシアニン顔料の合成 ( VOPa )

合成:1 D ガロンのグラステール プハウドラー反応器( glastes1 pfaudler reactor )中に、エチレングリコール 2 3.7 6 4、五酸化パナジウム 8 2 9.4 9、およびフタロニトリル 7 2 5 7 8を入れ、プロペラ式ミキサーで 7 D rpm で提择した。時間 - 温度の関係は、合成操作と共に次要に示した。また、添付図は、対応する図的説明を示す。

果積時間(時間 	]) 遵 度(°F) 温 度(°C)	操作
		開 始
0-0.75	70-90	反応器へ装入および加熱
	21-32	オイル シター ループ
		昇温すなわち部分 1
0.75-2.65	90-345	パツチにオープン「シター
	32-174	ループおよび発熱へ昇温
		始まり:194㎡(90℃)設定
		<b>搅拌器</b> : 100RPM
		部分Ⅱ
2.65-3.55	345-390-345	発熱期間
	174-199-174	
		なよび
3.55-5.55	345-320	発熱期間後
	174-160	•
		部分I
5.55-6.55	320-200	冷却降下
	160-93	濾過のための反応器内容物

発熱期間の間に生起する道度の意流のない、
反応器に水緩縮器を用いた。反応器内容物を90℃~95℃(194℃~203℃)に移むした。
熱い類科スラリーを真型フイルターに移動した。
類かー中を吸引波過斗上で、カカウの2があれた。
で~85℃)ジメチルホルムではおいの子の2がないのである。
でのためして1.4がロンプロパンプロルはなります。
く55℃にて1.4がロンプロパンプロルは、
かたれたのを動けるためである。

3 0 ガロンのスチームジャケント付きステンレススチール製タンクに、水酸化ナトリウム 3447 8、および脱イオン水 2 2.8 ガロン (8 6.3 &)を加え、約 4 多水酸化ナトリウム水溶液になるようにした。これに、類科ケーキを、セラミンク製液斗から移し、得られたアルカリ 性類料スラリーを、プロペラ式ミキサーで撹拌 (4 0 0 ~ 5 0 0

rpm ) しながら 7 0 ℃~ 7 5 ℃ に加熱し、提拌し ながらこの温度範囲に1時間保持した。次いで、 この顔料スラリーを、真空濾過し、濾過ケーキを、 セラミック製源斗上で、真空濾過(ポンプ)条件 を維持しながら、予め温められた(10℃~15 ℃)脱イオン水の10ガロンを用いて洗滌した。 この湿つた類科ケーキを前述のステンレススチー ル製タンクに移し、前述の条件と同じ条件で、熟 い脱イオン水スラリー(水25ガロン)を造つた。 この類科スラリーの真空濾過後、類科ケーキを前 記慮斗上で予め暖めた(70℃~75℃)脱イオ ン水の5ガロンを用いて洗滌した。この湿つた額 科を、65℃~70℃の敷対流エアーオープン中 に置かれた乾燥用トレー中に移し、96時間以上 乾燥した。乾燥した粗颜料を軽く粉砕し、秤量に より 4.8 5 0 8 を得た(装入した五酸化パナジゥ ム中の当量を基準として92多収率)。

段階 🛘: 最初の精製: ペルムトイド影測

この段階においては、粗無料を、75多硫酸を 用いて浸出し、不溶解にしてかつ溶媒で影濁した 類料粒子から不純物を密解し除去した。この不純物は、合成において、おそらく過剰のフタロニトリルから熱的に生成したものであり、これは75多硫酸中に浸出され加水分解された。このケースにおいては、原不純物および加水分解剛生成物である不純物はこの精製方法で大部分除去された。

3 0 ガロンのポリタンク(その外部は氷と水で 冷やされている)に、氷 5 0.1 6 15g、次いで 9 6 多酰酸 4 4.2 ℓ を加えた。酸を氷に加え実質 的に液体相になつたとき、機械的撹拌を始めた。 7 5 多酰酸溶液が 2 2 ℃になるまで、外部冷却を 続けた。

粗パナジル・フタロシアニン48508を、前述の如く調製しかつゆつくりと撹拌した759碗酸に、15~20分間かけて分割して添加した。このスラリーは、添加の間、室温または室温近くに残し、次いで撹拌しながら3時間維持した。ポリタンクを、プラスチンク板を用いて大気から對止し、類料と酸の塊を室温において夜通し(16~20時間)放置した。

4 37

顔料と敵の塊の ½ をフイルターに移し、真空 に吸引した。頗料ペーストを、フイルターのフィ ルター用布上で、単温において、新しいフラダ斑 殿の約4℃で洗滌した。液体を吸引によつて除去 後、顔料ペーストを、フィルター用布から櫛で梳 くように取り、脱イオン水るガロンを含有する他 のポリタンクに移した。次ぎの顔料と敗の塊の % を、 同様な方法で濾過し、そして移した。同 徴に、最後の % に、 前に集めた顔料およびその 水性媒体を加え、雄過した。この方法においては、 顔料の全てを開斗上に集め真空濾過を行つた。次 いで、湿つているケーキを、真空濾過を行いなが ら、フィルター上で、予め吸めた(10℃~15 ℃)脱イオン水の 6~8 ガロンを用いて洗滌した。 30ガロンのジャケット付きステンレススチー ル製タンクに、水酸化ナトリウム25858およ び脱イオン水 6 4.3 4 8 を加え、約 4 5 アルカリ 水裕黻を造つた。これに、前述の水洗した鎮料ケ ーキを加え、このアルカリ性顔料スラリーを、適 **遊に攪拌しながら10℃~15℃に加熱した。と** 

の熱スラリーを濾過する前に、挽拌および加熱を. 1時間続けた。次いで、この湿つた顔料ケーキを、同じ条件を使用し、同じ容器中にて、脱イオン水の22ガロンを用いてスラリーにした。次いで、フイルター上の湿つた顔料ケーキを、予め暖めた(70℃~75℃)脱イオン水の5ガロンを用いて洗滌した。

引き続いて、3種のジメチルホルムアミドスラリーを、18ガロンのジャケット付きステンススチール製タンク中にて行つた。前 送のの8ガビー中およびジメチルホルムアミ 前配温度にないて1時間後、顔料スラリーを真空減過した。 前配温度によっの段落に述べた操作を2回以上繰返し、最終にこの段落に述べた操作を2回以上繰返し、最終によって、下め暖めた(80°°°、次ができずい、アン・で洗滌した。

「最後に、顔料を、30ガロンのジャ ケット付き ステンレススチール製タンク中で10℃~15℃

に保持されている脱イオン水22ガロンを用い、通常の方法で1時間スラリーにした。真空濾過後、湿つた顔料を涌斗上で風乾し(4時間~6時間)、次いで乾燥用トレーに移した。この顔料を65℃~70℃において少なくとも96時間乾燥し、その後、穏かに粉々にした。収量は426gでありこれは部分的に糟製したパナジル・フタロシアニンの88%であつた。

#### 段階Ⅱ:最後の精製:酸ペースト化

この段階においては、部分的に精製した顔料を 969 貮酸中に溶解した。この硫酸は、また、前 述の浸出方法によつて除去されない残余の不純物 を溶解した。次に、飯料と酸の溶液を氷水中にて 冷却した。これにより2つの仕事を違成させた。 即ち、平均粒子サイズを、平均において、1~2 ミクロンから200~600オングストロームに 彼少させ、更に、生成した酸水溶液(冷却が完了 したとき、約259硫酸が生成した)は、可溶性 不純物を溶解した。

9 6 多硫酸 ( 2 4.5 ℓ ) を、この冷却された酸

に大気覆分が緩縮する量が最小になるようにしながら、1.5 時間~2.0 時間かけて6℃~10℃に冷却した。前記の半糟製顔料(2100分)を、外部冷却でパンチ風度を6~15℃に維持しながら、1.7 5時間~2.0 0時間かけて、前記の冷却した濃硫酸に、添加量を増加(約300分)させながら添加した。添加時間を通して、プロペラ式ミキサーの少なくとも100rpmの撹拌速度を維持し、その後1時間維持した。その間、類料・酸溶液の温度は10℃~15℃であつた。

冷却された飯料・酸酪液を、脱イオン水の
1 0.3 ガロンおよびポリタンクの内容物を5℃~
1 0℃に冷却するのに充分な氷を含有している
5 5 ガロン容のポリタンク中に、1 7 5 ± 2 5 ㎡
/分の森加速度で、流れさせながら供給した。氷の最初の1 9 6 1 bs の残りを、顔料・酸稻骸の添加時間の間、添加量を増加させながら瘀加した。 過剰の氷(これは渦巻きを妨げる)は避け、撹拌速度は800 rpm~1 000 rpm に維持した。類科・酸稻骸を添加する中断されない全時間は、

特開昭 61- 28557 (14)

235

2.6 7 時間 ~ 2.8 3 時間であり、メンク内容物は その時間を通して8℃~12℃であつた。類料の 酸の中における全帯留時間は、氷水による冷却前 6時間以下であつた。タンクの内容物を、添加を 完了するのに要する時間を越えること 0.5 時間の 間、400 rpm ~ 500 rpm にて攪拌した後、冷 却された希準硫酸-頗料スラリーを真空濾過した。 濾過はゆつくり(1夜かけて)行つた。黄色遮蔽 中には微粉がなかつた。朝になり、波道ケーキを 備斗上にて、予め腰めた(10℃~15℃)脱ィ オン水(5×2ガロン)を用いて洗滌した。残余 の酸を、30ガロン容のジャケット付きステンレ ススチール製タンク中において、70°0~75°0 に加熱された脱イオン水の25ガロン中に、1時 、間、顔料をスラリー化することによつて飲去した。 この熱い類科と水のスラリーを真空濾過した。

次の3種の水酸化アンモニウムスラリーを、残余の硫酸を硫酸アンモニウムとして除くために造つた。この方法においては、前述と同じ30ポロンの容器を呼べ、撹拌速度(400~500 rpm)

および高温(10℃~15℃)における加熱時間 (1時間)も同じであつた。続いて、各スラリー は、真空濾過を行つた。

(第1) NH4OHスラリー: 1 5.5 ガロンの脱イオン水と 7.8 4 の 複 NH4OH

(第2)NH40Hスラリー: 1 6.8 ポロンの脱イオン水と 4.9 & の 機 NH40H

(第3) NH40Eスラリー: 1 6.8 ガロ ンの脱イオン水と 4.9 ℓの 線 NH40H

機余のも種の脱イオン水スラリーの目的は、マイクロモー(micro mho)単位の 導電率によつて 制定される類科粒子中のイオン性 種の量を減少することであつた。約10マイクロモー以下(室温において)の許容しうる類科スラリーの濾水の値を、精確な光受容器のために類科がイオン性の異物を全く含有しないようにするのを確保するために、速成させなければならない。

水酸化ナンモニウムのために述べた装置および 条件を維持した。その代り、各スラリーに22ガロン~25ガロンの脱イオン水を使用した。一般

に、6~8 スラリーが、導電率を約1 0 マイクロ モー以下に低くするのに要求された。

最終的に渡過した顔料を、熱対流エアーオャプンによる乾燥のためにトレーに移した。との顔料を60℃~65℃にて4日間乾燥し、顔料の塊を手で破砕し、その後、同温度において24時間乾燥した。次いで、顔料を、乳鉢および乳棒を用いて粉々にし、同温度で、真空オープン中で乾燥を再びて粉々に、16時間、真空オープン中で乾燥を再び行つた。最後に、顔料を袋につめ、それを光のない場所に貯えた。

夹施例2

gen i jedin<mark>gskoja</mark>njeje i jeje

段階 1 : <u>粗パナジル - フタロシアニン類料の合</u> 成 ( VOPc )

合成: 1 0 ガロンのグラステール プハウドラー反応器中に、エチレングリコール 2 3.7 6 ℓ、五象化ペナジウム 8 2 9.4 9、およびフタロニトリル 7 2 5 7 9を入れ、プロペラ式ミキサーで7 0 rpm で携押した。時間 - 温度の関係は、合成操作と共に次表に示した。また、振付図は、対応する図的説明を示す。

表

果很時間 (時間)	温度(『ア) - 風度(『ひ)	操作
		研始
0 - 0.75	70-90 21-32	反応器へ要入および加熱 オイル シター ループ
		昇風すなわち部分!
0.75-2.65	90-345 32-174	パッチにオープン シーター ループおよび発熱へ昇風始 まり: 194下(90℃) 飲定 攪拝器: 100 RPM
		部分Ⅱ
2.65-3.55	345-390-345 174-199-174	<b>希熱期間</b>
		# I U
3.55-5.55	345-320 174-160	発 縣 期 随 後
		部分Ⅱ
5 - 55-6 - 55	320-200 160- 93	冷却降下濾過のための反応 内容物

. ....

発熱期間の間に生起する道度の環流のために、 皮応器に水暖稲器を用いた。反応器内容物を90℃ ~95℃(194下~203下)に冷却した後、 熱い顔料スラリーを真空フィルターに移した。鋼 料ケーキを設引速過後、新科ケーキを、排気され たセラミック製傷斗上で、予められた(80℃ ~85℃)ジメチルホルムアミドの2ガロン量を 用いて発展した。4回の鋭くないで予めな チルホルムアミドで洗練し、次いで予めな く55℃にて1.4ガロン 1イソプロパノールを用 いて洗かった。このイソプロパノールは、 4年に といている高那点のジメチルホルムアミトを除去するのを助けるためである。

3 ① ガロンのスチームジャケット付きステンレススチール製タンクに、水酸化ナトリウム 3447 8、および脱イオン水 2 2.8 ガロン (86.3 8) を加え、約4 多水酸化ナトリウム水 啓放になるようにした。これに、顔科ケーキを、セラミンク製剤斗から移し、得られたアルカリ性顔料スラリーを、プロペラ式ミキサーで撹拌(400~500

rpm )しながら 7 0 0 ~ 7 5 0 に 加熱し、 撹拌しながらこの 温度範囲に 1 時間保持した。 次いで、この 類料スラリーを真空 確過した。

引き続いて、 2 種のジメチルホルムアミドスラリーを、 1 8 ガロンのジャケット付きステンレススチール数タンク中にて行つた。 前述の過 ガロン 解析ケーキおよびジメチルホルムアミドの 8 日でに加熱した。 前配温度において 1 時間後、 鱗科スラリーを真空雄過した。 な終れて 2 回以上織返し、 敷終に この 酸落に述べた 操作を 2 回以上織返し、 飲終のた (80で) ジメチルホルムアミド(2×4&) で洗滌し、 次いでラガロン で洗滌した。

最後に、類料を、30ガロンのジャケット付きステンレススチール製タンク中で70℃~75℃に保持されている脱イオン水22ガロンを用い、通常の方法で1時間スラリーにした。 耳空 濾過後、優つた類科を頒斗上で風乾し(4時間~6時間)、次いで乾燥用トレーに移した。この類料を65℃

~ 7 0 ℃において少なくとも 9 6 時間 乾燥し、 その後、 穏かに粉々にした。 収量は 4 2 6 9 であり、これは部分的に 棺製したパナジルーフタロシアニンの 8 8 % であつた。

段階』は省略した。

段階Ⅲ:最後の構製:酸ペースト化

> 9 6 多硫酸(2 4.5 ℓ)を、この冷却された酸 に大気優分が凝縮する量が最小になるようにしな がら、1.5 時間~2.0 時間かけて 6 ℃~1 0 ℃に 冷却した。 町配の半槽製顔料(2 1 0 0 ៛)を、

外部冷却でパッチ 温度を 6 ~ 1 5 ℃ に維持しながら、 1・7 5 時間~ 2・0 0 時間かけて、 前記の冷却した機体酸に、 添加量を増加(約300 8 部づつ)させながら 添加した。 添加時間を通して、 プロペラ式ミャサーの少なくとも100 rpm の 提拌 速度を維持し、 その後1 時間維持した。 その間、 単科・酸 密 液の 温度 は10 ℃~ 15 ℃ であつた。

冷却された類科 - 製剤板を、脱イオン水の10.3 ガロンおよびポリタンクの内容物を5℃~10℃に冷却するのに充分な氷を含有している555 ガロン容のポリタンク中に、175±25 配/分の添加速度で、流れさせながら供給した。氷の最間の196 2bs の幾りを、類科 - 製幣を被のが添加時間の196 2bs 3時間であり、タンク内容、類科 - 製料 - 製部を設加する中断されない全時間は、2.67時間~2.83時間であり、タンク内容、類科 - 製料 - 製料 を変加する中断されない全時間は、2.67時間~2.83時間であり、メンク内容、類科 - 製料 - 製料 を変加する中断されないと、対力の時間であり、メンク内容、類科 - 製料 - 製料 - 製料 を適して80~12℃であつた。類科 の時間を活して80~12℃であつた。類科 の時間を活ける金幣留時間は、氷水による冷却的6時間

るのに要する時間を越えること C.5 時間の間、 4 D O rpm ~ 5 O O rpm にて提昇した後、冷却さ れた希寒疏散・顔料スラリーを真空濾過した。線 には飯粉がなかつた。朝になり、濾過ケーキを、

以下であつた。メンクの内容物を、添加を完了す

過は歩つくり(1夜かけて)行つた。黄色雄骸中 獅斗上にて、予め暖めた(70℃~75℃)脱ィ オン水(5×2ガロン)を用いて洗練した。残余 の酸を、30ガロン容のジャケット付きステンレ ススチール製タンク中において、70℃~75℃ に加熱された脱イオン水の25ガロン中に、1時 間、顱料をスラリー化することによつて除去した。 この熱い顔料と水のスラリーを真空礁過した。

次の3種の水酸化アンモニウムスラリーを、残 余の硫酸と硫酸アンモニウムとして除くために造 つた。この方法においては、前述と同じ30ガロ ンの容器を用い、撹拌速度(400~500rpm) および高温(70℃~75℃)における加熱時間 (1時間)も同じであつた。続いて、各スラリー は、真空雄遇を行つた。

ンによる乾燥のためにトレーに移した。この顔料 を60℃~65℃にて4日間乾燥し、顔料の塊を 手で破砕し、その後、同温度において24時間乾 燥した。次いで、頭科を、乳鉢および乳棒を用い て粉々にし、同温度で、真空ホープン中で、U.5 Ra Hg で、16時間、真空ォープン中で乾燥を再 び行つた。最後に、顔料を姿につめ、それを光の ない場所に貯えた。

#### 寒施例3

実施例1の操作によつて造つた1連のパナジル - フタロシアニン試料の納度を、TGA技術を用い て側定した。複々の虚度において、各ペナジルー フォロシアニン試料の重量損失の多を一覧表にし て以下の表に示した。この表から明らかな如く、 全てのパナジル・フタロシアニン試料は、低温 ( <del>1 5 0</del> で以下の T ) における 重量損失の始まり および400℃における全重量損失によつて示さ れている如く、少貴の不純物を含んでいた。#500 以下における重量損失は、残留している水および 啓媒に基因すると思われる。また、300℃にお

(第1) NH4 OH スラリー: 1 5.5 ガロンの脱イオ ン水と 7.8 ℓ の 優 NH40H

(第2) NH₄OH スラリー: 1 6.8 ガロンの脱イオ ン水と 4.9 ℓの濃 NH₄OH

(第3) NH4 OH スラリー: 1 6.8 ガロンの脱イオ ン水と 4.9 & の 濃 NH4 OH

残余の6種の脱イオンホスラリーの目的は、マ イクロモー ( micro mho ) 単位の 導電率によつて **側定される顔料粒子中のイオン性 榧の量を減少す** ることであつた。約1日ミクロモー以下(室温化 おいて)の許容しうる顔料スラリーの越液の値を、 精確な光受容器のために厳料がイオン性の異物を 全く含有しないようにするのを確保するために、 達成させなければならない。

水酸化アンモニウムのために述べた萎懼および 条件を維持した。その代り、各スラリーに22# ロン~25ガロンの脱イオン水を使用した。一般 に、6~8スラリーが、毎電率を約1日マイクロ モー以下に低くするのに要求された。

最終的に確遇した顔料を、熱対ルエアーオーブ

ける重量損失は、フタロニトリル、フタルジアミ ド、およびフタルアミン酸のような不純物に基因 すると思われる。これらの有機不純物は、光導電 性類料の電気的性質に影響を与える。殆んど全て の額料(試料4以外)は、重量損失の始まり (170℃以下のⅡ)の側定値によって示されて いる如く、完全に乾燥はされていない。400℃ を越えるTGA価は、不納物に関して意味はない。 何故なら、パナジル・フタロシアニン自体が昇華 し始めるからである。AR-2ォートペランス (Autobalance)、ミクロプロセッサー (System - 4 ) ( microprocessor ) 、および日立 X - Y記 録針を設備したパーキンエルマー機直蓋分析シス テム ( Model TGS - 2 ) ( Parkin Elmer Thermogravine tric System )を包含する重量損失を期 定するための特定の操作および装置を、この実施 例において使用した。伊および炉チューブの内部 を不活性雰囲気にするために、キャリャーガスと してヘリウムガスを使用した。ヘリウムガスの流 速は、約6日配/ min に設定した。分析を始める

正確さが落ちる。

削に、正確な盛度御定を確保するために、ミクロ プロセッサーによつて熱塩量分析( TGA )装置を 補正した。パナジル・フタロシアニン試料(約2 - 7 9 )を白金皿中に飽きその重量を正確に側定 した。試料重量の9日系を圧縮し、凶妻紙の全目 級を全敗散損失の10多を表すようにした。との ようにすることにより、無歴変化に基因する監査 損失の確少の変化を検出することができる。 顕符 以外の翅発性物質のために、試料重量は圧縮しな かつた。突厥はプログラムモードで行つた。試料 を、1分尚30°Cに平衡にし、次いで20°C/分 の逃旋で500℃に加熱した。500℃に避した とき渡ちに旗料は料を冷却した。TGAの記録線は、 値々な温度における富量損失のまを決定するのに 使用した。約450℃までの櫨々な温度(450℃ 以下のT)における肛歯損失データは、非常に艮 好で再現性があつた。しかし、400℃以上の重 並損失値は、顔料包子サイズによって変化する類 料の急退昇雄性、ホルダー中の試料分布、結晶度、 および貮料サイズ券に茲凶して、僅かではあるが

	かれて	N-78	n % 7	ニン試料の	骸	量分析	
		種々の	角展では	おける重	<b>登</b> 镇朱(	(%)	
其名	1.D. A	重量損失の始め	2000	2500	30070	3500	4000
. <del></del> -	15558-63	20,03	0.14	0.18	0.22.	0.28	0.35
2	15558-65	70°C	0.14	0.16	. 0.19	0.23	0.29
ĸi	15558-76	1900	0.03	0.07	0.12	0.17	0.24
4.	15558-89	20.09	0.13	0.18	0.25	0.31	0.40
மி	15558-95	150.0	90.0	0.16	0.20	0.29	0.35
્ંજ	15558-101	50°C	0.12	0.20	0.28	0.35	0.45
7	15558-103	45 °C	0.11	0.20	0.26	0.31	0.36
ಹ	15558-6	75.0	0.08	0.13	0.20	0.27	0.36
0	20162-8	2 56	0.09	0.12	0.19	0.23	0.30
10.	20162-10	20.05	0.12	0.21	0.30	Ú.38	0.44
11	20162-18	0. 59	0.10	0.20	0.29	0.34	0.40
12.	20162-20	0. S9	0.12	0.25	0.33	0.40	0.49

1

#### 実施例 4

実施例1の方法で造つたパナジル・フタロシア ニンを、単一層光受容器に組込んだ。この光受容 器はる工程によつて造つた。第1工程においては、 パナジル・フタロシアニンを、ポリエステルパイ ンダー重合体を塩化メチレン溶媒に溶かした液に 分散させた。第2工程においては、その分散放を - アルミニウム基体上に被覆した。第3工程におい ては、その破費を乾燥して磨媒を除去した。すな わち、第1工程においては、ポリエステルパイン メー重合体 [ PE - 2 0 0 : グットイヤー タイヤ アンド ラバー カンパニー ( Goodyear Tire and Rubber Co.) ] 1.7 7 8 を、± 0.0 1 時の正 確度で、分析用天秤を用いて秤量し、これを、ポ . リシール キャップ ( polyseal cap )を有する 2 オンスの琥珀色壜中に入れた。 灰いで、塩化メ チレン指媒の21.48を、上皿天秤上で±10号 の正備度で秤りながら、前記2オンス場中に直接 森加した。前記諸成分を含む機を、リストアクシ ヨンの振盪機 ( wrist action shaker ) 上に設置

し、重合体を溶解させた。パナジル・フタロシア ニン類料の D.4 3 8 を分析用天杵にて秤量し、こ の密放に加えた。ステンレススチールのショット 〔1/4 インチ、 ≠ 3 0 2 級の磨き仕上げをしたポ ール:シューペリアー ポール カンパニー殺 (Superior Boll Co.)、100ウイリングトン セント ハーツホード、コネチカツト州、 06106 ( 1 0 0 Willington St. Hartford, Conn. 06106)] の1508を上皿天秤にて秤量後前記場中に加え た。このステールショットは、予め塩化メチレン で洗練し、幾割している油を除き、ォーブン中で 100 下にて乾燥した。次いで、これらの諸成分 を有する場を、振機機( Cat. 165 1 D G X Red Devil, Inc., Union, New Jersey )上に90分 間置き離料を分散させた。この分散物を被模前に 室機に冷却させた。

前述の知くにして造つた分散物を、パード フィルム アプリケーター (Bird Film Applicator) (Gardner Laboratory, Inc. Box 5 7 2 8,5 5 2 1 Landy Lane, Bethesda, Md. 20014)

を有するガードナー メカニカル ドライブ フ イルム アプリケーター AG-3862 (Garaner Mechanical Drive Film Applicator Model A G - 3 8 6 2 ) ( Gardner Laboratory Inc. Box 5 7 2 8 , 5 5 2 1 Landy Lane, Bethesda, Md. 20014)を使用して、プランが付したアルミ ニウム ( Brush Grained Aluminum Plates LKK. 1 0 in. X 1 6 in. Ron Ink Company, Inc., 61 Halstead St. Rochester, NY ) 上に被値した。こ ·のプラシがけしたアルミニウム板を、3インチ× 10インチに切断し、長い方向に被覆した。巡つ ろミル(75ミクロン)であつた。この被撻は、 グローブを取りはずしかつその取りはずした場所 に設定したプラスチック製のスリットシールド ( slit shields )を有するグロープポックス ( glove box ) ( Cat. % 5 0 0.0 4  $\nearrow$  5 Labcameo Corp., Kansas City, missouri 6 4 1 3 2 ) 中に おいて行つた。このポックスは、乾燥空気を流し 連続した正圧下にし、相対虚度を20多以下に維

持した。この分散物を、3インチの薬学用の満下 ピペットを使用するペード フィルム アプリケ ーター(Bird Pilm Applicator)の前のアルミ ニクム板(予め塩化メチレンで洗滌した)上に置 いた。

この被覆された板を、ドライポックス中にて30分間を使した。次いで、これを、真空オープン(vaccum oven)(Cat. %31566 Precision Scientific Co., U.S.A.)中に置き、重盛にて約30 in. Hg の減圧(DUO Seal Vacuum Pump Model 1405 Welch Scientific Co., 7300N.

Linder Ave., Skokie, Illinois)にて1時間保持した。この板をオープンから取り出し盗過に冷却した。次いで、光受容器の厚さを、パーマスコープ タイプ3C Se2Ty(Permascope Type EC Se2Ty)(Twin City Testing Corporation, P.O. Box 248, Tonawanda, NY 14150)を用いて測定した。単一層光受容器の厚さは約104クロンであつた。

電気的測定は平板走査計 (flat plate scanner)

上で行つた。この走査計は、モーターで収動する 往復ペルト、そのペルト上に光受容器が置かれる 往復ペルトから成つている。この可規性ペルトの ために、試料を先ずペルトの上面に収付けた厚い (50 mm) アルミニクム板(5×5cm²) 上に取付 け接地した。次いで、ペルトおよび試料を像解出 部へ動かした。後毎出部は、光源、フイルター、 電子シャッター、およびエレクトロメーターから 成つている。像英出部においては、表面電位を、 **クーロンモードにてカイスレーエレクトロメータ** - ( Keithley electrometer ) ( Model 610C) (Keithley Instruments Inc., 28775 Aurora Road, Cleveland, Ohio 4 4 1 3 9) に連結した 膀電結合されたリング プローブ (ring probe) を用いてモニターした。 エレクトロメーターの出 力は、未被機試料(むき出しの板)に既知の電圧 . を適用することによつて検量されるストリップ チャート レコーダー ( HP Model 7 4 0 2 A ) ( Hewlett Packard Inc.)上に表示した。暗放電 は聞きるれたシャッターで側定し、既知の光の強

さに対する放電は、シャッターの開きで記録した。 時間の関数として、電圧のストリップ チャート 記録を行つた。チャート記録針の速度は125幅 /秒であつた。 電圧の最初の上昇は、 プロープ下 に動く荷電試料に基因することが観察された。約 680ポルトのピーク電圧( VDDP )は、試料が 停止したときに観察された。このピーク電圧から、 **賠放置に基因して、電圧は減少し、これは賠放電** 速度の側定を提供した。光放電を側定するために、 ピーク 電圧に通したときシャッター を開け、 光受 容器を一定の強さの光に露光した。光は、1次の 干渉かつ中密度のフイルターで護過し、597 nm において、32エルゲ/cm²/炒のフラックス(flux) を得た。放電は直ちに始らないで、「誘導期」の 後で起つた。光受容器の感度は、2つのパラメー ター、すなわち、露光に対する最大放電速度およ び最大速度に達するのに要する解光によつて特徴 づけられる。後者は、電圧が時間=①において. V<sub>DDP</sub> の値の半分になるときに生起する故に、時間 = 0 から ½ v<sub>DDP</sub> に避する時間までの腐光として

#### 等施例 5

実施例2の顕料製造操作を繰返して第1試料の ための顕料を製造した。

帝却タンク中の氷水の代りに、 室風水を使用した以外は実施例 2 の顔料製造操作を使用して、 第 2 試料用の顔料を製造した。

第3世科用の対照無料を契施例1に記述した如

き五酸化パナジウムから造った。 正確な比較のために、 本実施例および次の実施例における対照 接置を製造する方法は、 他の装置が対照 装置と比較されるのと同じ日に行った。 それ故、 紅科 1 および試料 2 用の装置は、 対照 装置 3 と同じ日に 造った。 これらの試料から造られた単一層の光受容器の電気試験の結果は次表に示した。

単一層の光受容器裝置は、実施例4に述べた操作および割合を使用して、これらの顕料から進つた。これらの光受容器は、実施例4に述べた方法で電気的性質を試験した。電気的試験の結果を次表に示す。

鎖 料 試料 / / /	毎 選 後(ポルト/秒)	要 俊 版 度 E 1/2 V DDP (エルケ/cm <sup>2</sup> )
1	30	28
2	2 0	26
3	3 0	2 4

一般に、対照によつて示された暗域段の10ポ

ルト/秒以内の暗滅衰は許容される。しかし、感光性(エネルギー・/e V<sub>DDP</sub> エルグノcm²)は、対照試料3と比較して試料1および2は幾分少ない(大きい数字は少ない感光性を示す)。

#### 実施例 6

第1 試料用の類料を、実施例2 に述べた方法で造つた。第2 試料用の対照顔料を、実施例1 に述べた如く五段化パナジウムから造つた。

これらの類料から、単一層の光受容器装置を、 実施例4に述べた操作および割合を使用して造っ た。これらの光受容器は、実施例4に述べた方法 で電気的性質を試験した。電気的試験の結果を次 表に示す。

#### 雯

飲料/6	装 僧 端 浚 袋(ポルト/秒)	要置級度 E 1/2 VDDP(エルケ/cm²)
<sub>.</sub> 1	4 0	2 4
2	3 D	1 9

再び、感光性は、対照試料2と比較して試料1

## は幾分少ない。 実施例 7

帝却タンク中の氷水の代りに、窒 風水を使用した以外は実施例 2 の方法を使用して、他の試料用の類料を造つた。この顔料から、単一層の光受容器を、実施例 4 に述べた操作および割合を使用して造つた。この光受容器は、実施例 4 に述べた方法で電気的性質を試験した。有意の荷電許容は観察されなかった。

#### 実施例8

吳施 例 1 1

実施例1に述べた標準3段階類料製造操作を使用した。しかし、冷却メンク中の氷水の代りに富處水を使用した。この場合には、熱節例4に述られた類性をはよび割合を使用して、前記の如く得るでは無料を用いて造つた単一層光受容器は、術電を許容した。しかし、20~40ポルトの通常と比較して190.275ポルト/秒の確めて高い暗滅衰を示した。これは、類科な子中に捕捉された不純物の有意量の存在を示している。

#### 寒 施 例 9

五限化パナジウムの28多過剰(5559過剰に比較して)だけを段階Iに使用した以外は、実施例1と同様な顕料製造操作を繰返した。その収率は、559週別の五酸化パナジウムを用いる92多~99多の通常の収率と比較して約79多であった。実施併4に述べた操作と割合を用い、得られた頻料を用いて造つた単一層の光受容器装置は、約35ポルト/秒の暗波設、および約26のB½2VDDP(エルグ/cm²)を示した。後者の感光度の値は、約に使用した対照に対して低い感光度を示した。

## 実施例10

発散を魅的に不足させ、その結果、通常の198°C(またはニチレングリコールの沸点)の代りに、約130°Cの散大過度を設階」において達成させた以外は、実施例1と同様な類料製造操作を繰返した。この収率は、実施例1に述べた材料および条件を練返したときの928~99多と比較して46多であつた。実施例4に述べた操作および割

三塩化パナジウムを五酸化パナジウムの代りに 用いた以外は、 前配の類料製造操作を繰返した。 次いで実施例 2 と同様な操作を行つた。

第2試料用の鎖料を、五酸化パナジウムの代り に三塩化パナジウムを用いて造した。ただし、実 施例1に述べた如き額準2-精製法を用いた。

第3試料用の類料を、第2試料から造り、実施 例1の段階Ⅲに従つて精製した。

第4試料用の額料を試料1の如くにして得た。 第5試料用の額料を、昇華した第4試料から造り、実施例1の段階Ⅱに従つて2回得裂した。

第6試料用の対照 顔料を、全て3 つの設階において実施例1 に述べた如く五酸化パナジウムから

造つた。

これらの類科から、実施例4に述べた操作および割合を使用して、単一層の光受容器装置を造った。これらの光受容器の電気的性質を、実施例4に述べた方法で試験した。この電気的試験の結果を次要に示した。

炎

節 料 武科/6	装 置 暗凛 袞(ポルト/砂)	装置 感度 E 1/2 V <sub>DDP</sub> (エルケ/cm²)
1	20	4 4
2	20	3 2
3	<b>2</b> 5 .	3 2
4	2 0	4 4
5	2 0	3 4
6 .	2 5	1 9

対照試料 6 と比較して試料 1 は、半分以下の感 光度を示した(4 4対 1 9 )。試料 2 および 3 に 関しては、実確例 1 の段階 3 および段階 II の工程 を使用することにより、感光度が約 4 4 から約

額 料 試料//i	接 置 暗 滅 袞 (ポルト/秒)	装置 感度 B 1/2 V <sub>DDP</sub> (エルケ/cn <sup>2</sup> )
1	3 5	2 4
2	3 5	2 5
3	3 0	1 9

これらの結果は、一般に、短縮した飲料製造方法(実施例2)を使用したときは、 感光度が 減少 することを示している。

## 奥施例 1 3

実施例2の顕料製造操作を繰返して第1試料用

第2試料用の対照資料を、実施例1 に述べた如 く五酸化パナジウムから進つた。

これらの顔料から、実施例 4 に述べた操作および割合を使用して、単一層の光受容器装置を造った。これらの光受容器の電気的性質を、実施例 4 に述べた方法で試験した。この電気的試験の結果を次袋に示した。

3 2 に改良されたが、しかし、このように改良された感光度でも、まだ、対照顧料 6 の設置感度 1 9 より非常に劣つていた。

吳施例 1 2

実施例2の頻料製造操作を繰返して第1試料用の顔料を造つた。

冷却タンク中の氷水の代りに室虚水を使用した 以外は、実施例2の銀料製造操作を練返した。

第3試料用の対照版料を、実施例1に述べた如 く五酸化パナンウムから進つた。

これらの顔料から、実施例4に述べた操作および割合を使用して、単一層の光受容器要置を造った。これらの光受容器の電気的性質を、実施例4に述べた方法で試験した。この電気的試験の結果を次要に示した。

焸

類 科 <u>試料//6</u>	接 徹 景(ポルト/秒)	要 版 版 度 E <sup>1</sup> /2 VDDP (エルグ/cm²)_
1	3 5	1 8
2	3 0	1 7

これらの結果は、一般に、短縮した飲料製造方法(実施例2)を使用したときは、 服光度の減少は、時々、無意味になる。

#### 夹施例 1 4

上塗りされた光受容器ドラムを、 3 インテの直径を有する情景なアルミニウム投シリンダー上に、アミンを負荷した輸送層を 2 1 型スプレー ガン (Model 21 spray gun) (Biuka Inc. から市版されている)を用いて喫霧して造つた。 この喫霧は、輝発性再降を用い、入口手段および排気手段を有する暦空気流の吹付室が設計されている方法で行った。また、この吹付室は、モーターで駆動するマンドレスにして、その上に取付けられたアルミニクムシリンダーを有するマンドレルを有してい

持閒昭61-28557(22)

た。この吹付室は、温度20℃そして湿度約40 多に維持した。

ポリカーポネート歯脂 ( Merlon M 3 9 N; Mobey Chemical Co. から市販されている)の65 ダ( 重量 )、 およびN , ドージフェニル・N , ド -ピス(3-メチルフエニル)-1,1′-ピフェ ニル・4.4・ジブミンの35%(重量)の混合 物の4多固体階級を含む負荷輸送層を沈澄させた。 この混合物は、塩化メチレンの60g(容量)と 1,1,2-トリクロロエダンの40%(容量) を含む俗板に、ポリカーポネート樹脂を格解させ て造つた。このポリカーポネート機能は、琥珀色 の場の中で前記器液を、1時間、ペイントを振識 するようにして密解させ、仄いで24時間重温に て放置した。

次いで、待られた解液を、スプレーガンを用い てアルミニウムシリンダーに通用し、40℃にて 20分間、そして160℃にて60分間乾燥した。 乾練はエアーオープン中で行つた。アルミニタム シリンダー上の破損は、15ミクロンの厚さを有

し、かつ的記アミンの358(重量)および前記 ポリカーポネート歯脂の65gを含んでいた。

次いで、この輸送値を、パナジル・フタロシア ニンの30%(重量)をポリエステルの70% (重量)に分散させた写真生成性層( photogenerating layer )で被覆した。この写真生成性層 は、前述の Binks 社製 Model 2 1 スプレーガンを 用いて適用した。

写真生成用組成物は、ペナジル・フタロシアニ ンの30多(宜量)とポリエステル(PE-100) Polyester: Goodyear 社から市販されている)の 70万(重量)を混合することによって造った。 この混合物を、塩化メチレン裕線と1.1,2-トリクロロエチレン器族の60/40容量比の偽 合物を含んでいる就 珀色の塩中に入れた。 約3 麻 の直径を有するスチールショットをこの増中に加 えた。次いで、この場の内容物を、ペイントシェ カー上で24時間混合した。次いで、スチールシ ョットを確過によつて除き、充分な角膜を加えて パナジル・フタロシアニンの1 多固体およびポリ

エステルを含む混合物を進つた。次いで、この混 合物を、 Brinks 社製のスプレーガンを用い、前 述の如くにして造つたジアミン負荷輸送層上に噴

噴磐後、被覆された装置を100℃にて1.25 時間エアーオープン中で乾燥し、約1ミクロンの 乾燥した厚さを有する写真生成性層を生成させた。

次いで、トップの紫外級吸収上置り層を、負荷 **他送層および写真生成性層を含む被覆されたアル** ミニウムシリンダーを真空軍中に置き、写真生成 性層上に、セレニウムの98%(重量)と砒素の 2 % ( 重量 ) を含む合金を真空蒸発させることに 「Allystonese」よって、写真生成性層に適用した。真空盤は、モ ーターで水平に収動する回転軸、アルミニウムシ リンダーより長い長さを有する一列になつた4つ のるつ ぼを有し、シリンダーより12インチ離れ て位置していた。これらのるつぼの中には、砒米 - セレニクム合金ペレツトが入つており、真空室 は、ミクロ トル ( micro torr ) より低い圧力 に排気した。 アルミニウムシリンダーを、 輻射加

熟器で加熱しながら約200回転/分の速度で回 転させた。砒素~セレニウム合金を、るつ低の失 夫を300℃に加熱することによつて蒸発させた。

冷却後、得られた写真生成性層は、 趾素の約2 が ( 重量 ) とセレニウムの98% ( 重量 ) を含ん でおり、約1.5ミクロンの厚さであつた。

次いで、この装置を、コロトロン (corotron ) を用いて約800ポルトに正荷電し、 約400 nm -800 mの改長を有する光に像形にて選光し た。発生器層に本発明の改良された線料を使用す る光受容器を試験するための装置として次のもの を用いた:サイクリック ゼログラフィック ス キャンナー ( Cyclic Xerographic Scanner ) ; 光 受容器表面速度: 4 インチ/杪; 試験したサイク ル数(最大): 1 0 0,0 0 0 サイクル(サイクル ポルトの土100ポルト);光の強さ:露光2× 1 0<sup>-5</sup> ワット / cm² 、 商去 ( Brase ) : 2 × 1 0<sup>-4</sup> ヮット/cm²; 感度( w ½ は全装置のために使用 しない)、25エルゲ/cm² ; 暗咳衰:50ポルト

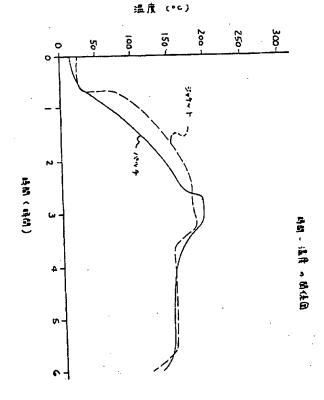
/秒以下、残留電圧:5円ポルト以下。

本発明を、特定の好ましい思様を参照として説明したが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。当業者は、本発明の精神および本特許請求の範囲の精神に入る種々の変様や態機が可能なことを容易に認識されるであろう。

#### 4.図面の簡単な説明

図は本発明方法における、時間・温度の関係図を示す。

代理人 浅 村 皓



第1頁の続き

@Int\_Cl\_1

識別記号

厅内整理番号

// C 09 C 3/08

7102-4J

⑩発 明 者 ジョン ダブリユ・ス アメリカ合衆国ニューョーク州ウェブスター。サアフロン ピーワック レーン 773

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

# THIS PAGE BLANK (USPTO)